

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2004-537757(P2004-537757A)

【公表日】平成16年12月16日(2004.12.16)

【年通号数】公開・登録公報2004-049

【出願番号】特願2003-517673(P2003-517673)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/32 (2006.01)

G 0 3 F 7/00 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/32

G 0 3 F 7/00 5 0 3

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月15日(2005.7.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

露光した平版印刷版前駆体を現像剤および補充剤を用いて現像する方法であって、該方法が、

露光した印刷版前駆体を現像剤を用いて現像する工程と、

現像剤の活性を相対的に一定に保持するように現像剤に補充剤を添加する工程とを含有し；

ここで、

印刷版前駆体が画像形成性層を含有し；

該画像形成性層はアルカリ性水溶液中に溶解可能なまたは分散可能な物質を含有し；

該現像剤はアルカリ性物質および現像剤溶解性の皮膜攻撃抑制剤を含有し；

該補充剤がアルカリ性物質及び皮膜攻撃抑制剤を含有し；

該補充剤中のアルカリ性物質が、現像剤中のアルカリ性物質よりも高濃度であり；

該補充剤中の皮膜攻撃抑制剤が、現像剤中の皮膜攻撃抑制剤よりも高濃度である、方法。

【請求項2】

皮膜攻撃抑制剤が、

ポリエトキシ化、ポリプロポキシ化、またはポリブチルオキシ化化合物；

少なくとも1つのポリオキシエチレンブロックおよび少なくとも1つのポリオキシプロピレンブロックを含有するポリマー；

ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、またはエチレンオキシドおよびプロピレンオキシドのブロックまたはランダムコポリマー；

ポリオキシエチレン / ポリオキシプロピレン / ポリオキシエチレン A - B - A ブロックコポリマー；

少なくとも1つのC₂ - C₄ アルキレンオキシドとエチレンジアミンとの重縮合物；

ポロキサミン；

4級アンモニウムクロリドで；または

構造：

【化 1】



(式中、

n は整数であり；

R¹ は、水素、C₁ - C₁₈ アルキル、C₁ - C₁₈ アリール、C₁ - C₁₈ 置換アリール、またはC₁ - C₁₈ アラルキルであり；

R² は、水素、メチル、またはエチルであり；

R³ は、水素、C₁ - C₈ アルキル、- CH₂ COOH、または - CH₂ COO⁻ M⁺ であり、ここで、M はアンモニウム、置換アンモニウム、ナトリウムまたはカリウムである) の化合物
 である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

アルカリ性水溶液中に溶解可能なまたは分散可能な物質が、フェノール性ポリマー、カルボン酸ポリマー、スルホンアミドポリマー、またはこれらの混合物である、請求項 1 または 2 に記載の方法。